(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-262712

(43)公開日 平成11年(1999) 9月28日

(51) Int.Cl.6

識別記号

101

8.0 5 C 5/00

H01L 21/52

FΙ

B 0 5 C 5/00

HO1L 21/52

101

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 12 頁)

(21)出顧番号

特願平10-67188

(22)出顧日

平成10年(1998) 3月17日

(71)出願人 000233077

日立テクノエンジニアリング株式会社

東京都足立区中川四丁目13番17号

(72)発明者 石田 茂

茨城県竜ケ崎市向陽台5 「目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所

世

内

(72)発明者 川隅 幸宏

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テ

クノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(74)代理人 弁理士 武 顕次郎

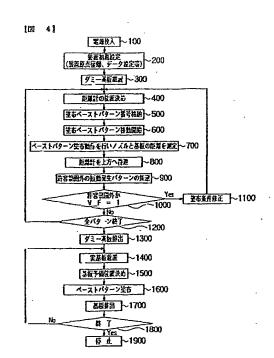
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ペースト塗布方法とペースト塗布機

(57)【要約】

【課題】 ペースト塗布速度を高めて、かつ可動部の振動を抑制し、所望形状のペーストパターンを良好に塗布することを可能として生産性を高める。

【解決手段】 ダミー基板を用い(ステップ300)、実際に用いるペーストパターンデータでペースト塗布しない模擬塗布動作を行なう(ステップ600)。この模擬塗布動作でノズルと基板間の距離を測定し(ステップ700)、許容範囲外の大きな振動を発生する塗布位置を探索する(ステップ700)。かかる塗布位置が存在すると、この塗布位置でのみ塗布速度を新たな塗布速度に修正する(ステップ1100)とともに、この新たな塗布速度で同様の模擬塗布動作を行ない、以下、かかる振動を発生する塗布位置がなくなるまで、順次塗布速度を修正しながら繰り返す。このようにして、振動を発生する塗布位置では、発生する振動の大きさに応じているが、かかる振動が発生しない塗布速度が設定される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ノズルの吐出口に対向するようにして基板をテーブル上に載置し、該基板の主面に垂直な方向での該ノズルと該基板との間の相対距離を所定に維持し、ペースト収納筒に充填したペーストを該吐出口から該基板上に吐出させながら該基板と該ノズルとの該基板の主面における相対位置関係を変化させることにより、該基板上に所望形状のペーストパターンを描画するペースト途布方法において、

該テーブル上に載置された所望基板と該ノズルとの相対 位置関係を所定の相対移動速度で変化させながら、該ノ ズルと該所望基板との間の該所望基板の主面に垂直な方 向での相対距離を検出する第1の工程と

該第1の工程で検出された該相対距離が予め設定された 許容範囲にあるか否か判定する第2の工程と、

該第2の工程によって該相対距離が該許容範囲外にあると判定されたとき、該所定の相対速度よりも所定量低減した速度を新たな所定の相対移動速度とし、該新たな所定の相対移動速度を用いて、該所望基板と該ノズルとの相対位置関係を変化させながら、該所望基板と該ノズルとの間の該所望基板の主面に垂直な方向での相対距離を検出する第3の工程と、

該第2の工程によって該相対距離が該許容範囲内にあると判定されたとき、そのときの該所定の相対移動速度を、所望形状のペーストパターンを描画するために該ノズルの吐出口からペーストが吐出される基板と該ノズルとの間の相対移動速度とする第4の工程とを備えたことを特徴とするペースト途布機。

【請求項2】 ノズルの吐出口に対向するようにして基板をテーブル上に載置し、該基板の主面に垂直な方向での該ノズルと該基板との間の相対距離を所定に維持し、ペースト収納筒に充填したペーストを該吐出口から該基板上に吐出させながら該基板と該ノズルとの該基板の主面における相対位置関係を変化させることにより、該基板上に所望形状のペーストパターンを描画するペースト塗布機において、

該テーブル上に載置された所望基板と該ノズルとの相対 位置関係を所定の相対移動速度で変化させながら、該ノ ズルと該所望基板との間の該所望基板の主面に垂直な方 向での相対距離を検出する第1の手段と、

該第1の手段が検出した該相対距離が予め設定された許容範囲にあるか否か判定する第2の手段と、

該第2の手段によって該相対距離が該許容範囲外にある と判定されたとき、該所定の相対速度よりも所定量低減 した速度を新たな所定の相対移動速度とし、該新たな所 定の相対移動速度を用いて該第1の手段を動作させる第 3の手段と、

該第2の手段によって該相対距離が該許容範囲内にある と判定されたとき、そのときの該所定の相対移動速度 を、所望形状のペーストバターンを描画するために該ノ ズルの吐出口からペーストが吐出される基板と該ノズル との間の相対移動速度とする第4の手段とを備えたこと を特徴とするペースト塗布機。

【請求項3】 請求項2において、

前記第3の手段によって前記新たな所定の相対移動速度 が設定される毎に、前記ノズルの吐出口からのペースト の吐出圧を低減するか否か判定する第5の手段と、

該第5の手段によってペーストの吐出圧を低減すべきと 判定される毎に、ペーストパターンを描画するときの前 記ノズルの吐出口からの設定すべきペーストの吐出圧を 所定量ずつ低減する第6の手段と、

前記第2の手段によって該相対距離が該許容範囲内にあると判定されたとき、該第6の手段で得られるペーストの吐出圧をペーストパターンを描画するときの前記ノズルの吐出口からの設定すべきペーストの吐出圧とする第7の手段とを備えたことを特徴とするペースト塗布機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ノズルの吐出口に対向するように基板をテーブル上に載置し、基板の主面に垂直な方向での該ノズルと該基板の相対距離を所定に維持して、ペースト収納筒に充填されたペーストを該吐出口から該基板上に吐出させながら該基板と該ノズルとの相対位置関係を変化させ、該基板上に所望形状のペーストバターンを塗布するペースト塗布方法とペースト塗布機に係り、特に、生産性を向上させるようにしたペースト塗布方法とペースト塗布機に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のペースト塗布機では、生産性を向上させるための方法として、ペースト収納筒に充填したペーストをノズルから基板上に吐出させながら、ノズルと基板との間の相対移動速度、即ち、ペーストパターンを塗布するときの速度(以下、塗布速度という)を上昇させていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、ベースト塗布機においては、上記従来技術のように、塗布速度を上昇させると、ベーストパターンの直線部では問題ないが、曲率半径の小さい曲線部では、塗布方向が直角に変化するとき、即ち、例えば、X軸方向からY軸方向あるいはY軸方向からX軸方向に塗布方向が変わるとき、移動している部分に振動が発生する。例えば、移動部分がノズルであって、固定部分が基板が載置される基板吸着盤である場合(即ち、基板に対してノズルが移動している場合)、ノズルの移動方向が変化すると、ノズルに垂直(Z軸)方向や水平(X,Y軸)方向の振動が発生し、特に、垂直方向の振動が大きい。また、固定部分がノズルであって、移動部分が基板吸着盤である場合(即ち、基板が移動している場合)でも、この基板吸着盤の移動方向が変化すると、基板吸着盤、従って、これに載

置固定されている基板に同様の振動が発生し、特に、垂直方向の振動が大きくなる。かかる振動は基板の周辺部、特に、角部において大きい。このため、ノズルと基板との間の距離が変動し、塗布精度が低下する。

【0004】つまり、図10に示すように、ノズル13 aと基板22との間の相対位置距離が8-2間で変動するために、単位時間当たりのペースト塗布量が変化し、所望形状のペーストパターン23が塗布形成できないという問題があり、しかも、塗布速度を上昇させる程ノズル13aと基板22との間の相対位置の変動が大きくなる。このため、塗布速度を高めることは不可能となり、生産性の向上を図かることができなかった。

【0005】本発明の目的は、かかる問題を解消し、塗布速度を高めて生産性の向上を図りながら、所望形状のペーストパターンを良好に塗布形成することができるようにしたペースト塗布方法とペースト塗布機を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明によるペースト塗布方法は、ノズルの吐出口 に対向するようにして基板をテーブル上に載置し、該基 板の主面に垂直な方向での該ノズルと該基板との間の相 対距離を所定に維持し、ペースト収納筒に充填したペー ストを該吐出口から該基板上に吐出させながら該基板と 該ノズルとの該基板の主面における相対位置関係を変化 させることにより、該基板上に所望形状のペーストパタ ーンを描画するペースト塗布方法において、該テーブル 上に載置された所望基板と該ノズルとの相対位置関係を 所定の相対移動速度で変化させながら、該ノズルと該所 望基板との間の該所望基板の主面に垂直な方向での相対 距離を検出する第1の工程と、該第1の工程で検出され た該相対距離が予め設定された許容範囲にあるか否か判 定する第2の工程と、該第2の工程によって該相対距離 が該許容範囲外にあると判定されたとき、該所定の相対 速度よりも所定量低減した速度を新たな所定の相対移動 速度とし、該新たな所定の相対移動速度を用いて、該所 望基板と該ノズルとの相対位置関係を変化させながら、 該所望基板と該ノズルとの間の該所望基板の主面に垂直 な方向での相対距離を検出する第3の工程と、該第2の 工程によって該相対距離が該許容範囲内にあると判定さ れたとき、そのときの該所定の相対移動速度を、所望形 状のペーストパターンを描画するために該ノズルの吐出 口からペーストが吐出される基板と該ノズルとの間の相 対移動速度とする第4の工程とを備える。

【0007】また、本発明によるペースト塗布機は、ノズルの吐出口に対向するようにして基板をテーブル上に 載置し、該基板の主面に垂直な方向での該ノズルと該基 板との間の相対距離を所定に維持し、ペースト収納筒に 充填したペーストを該吐出口から該基板上に吐出させな がら該基板と該ノズルとの該基板の主面における相対位

置関係を変化させることにより、該基板上に所望形状の ペーストパターンを描画するペースト塗布機において 該テーブル上に載置された所望基板と該ノズルとの相対 位置関係を所定の相対移動速度で変化させながら、該ノ ズルと該所望基板との間の該所望基板の主面に垂直な方 向での相対距離を検出する第1の手段と、該第1の手段 が検出した該相対距離が予め設定された許容範囲にある か否か判定する第2の手段と、該第2の手段によって該 相対距離が該許容範囲外にあると判定されたとき、該所 定の相対速度よりも所定量低減した速度を新たな所定の 相対移動速度とし、該新たな所定の相対移動速度を用い て該第1の手段を動作させる第3の手段と、該第2の手 段によって該相対距離が該許容範囲内にあると判定され たとき、そのときの該所定の相対移動速度を、所望形状 のペーストパターンを描画するために該ノズルの吐出口 からペーストが吐出される基板と該ノズルとの間の相対 移動速度とする第4の手段とを備える。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図面を用いて説明する。図1は本発明によるベースト塗布機の一実施形態を示す斜視図であって、1は架台、2a,2bは基板搬送コンベア、3は支持台、4は基板吸着盤、5は分軸移動テーブル、6a,6bはX軸移動テーブル、7はY軸移動テーブル、8a,8bはサーボモータ、9はZ軸移動テーブル、10はサーボモータ、11はボールねじ、12はサーボモータ、13はベースト収納筒(シリンジ)、14は距離計、15は支持板、16a,16bは画像認識カメラ、17は制御部、18はモニタ、19はキーボード、20は外部記憶装置を備えたパソコン本体、21はケーブルである。

【0009】同図において、架台1上には、X軸方向に並行で、かつ昇降可能な2つの基板搬送コンベア2a,2bが設けられており、図示していない基板を図面の奥の方から手前の方に、即ち、X軸方向に水平に搬送する。また、架台1上に支持台3が設けられ、この支持台3上にの軸移動テーブル5を介して基板吸着盤4が載置されている。このの軸移動テーブル5は、基板吸着盤4をZ軸廻りのの方向に回転させるものである。

【0010】架台1上には、さらに、基板搬送コンベア2a,2bよりも外側でX軸に平行にX軸移動テーブル6a,6bが設けられ、これらX軸移動テーブル7をはられている。このY軸移動テーブル7は、X軸移動テーブル6a,6bに設けられたサーボモータ8a,8bの正転や逆転の回転(正逆転)によりX軸方向に水平に搬送される。Y軸移動テーブル7上には、サーボモータ10の駆動によるボールねじ11の正逆転によってY軸方向に移動するZ軸移動テーブル9が設けられている。このZ軸移動テーブル9には、ベースト収納筒13や距離計14を支持固定した支持板15が設けられ、サーボモータ

12がこれらペースト収納筒13や距離計14をこの支持板15に設けられた図示していないリニヤガイドの可動部を介して2軸方向に移動させる。ペースト収納筒13は、このリニヤガイドの可動部に着脱自在に取り付けられている。また、架台1の天板には、図示していない基板の位置合わせなどのための画像認識カメラ16a、16bが上方向を向けて設けられている。

【0011】架台1の内部には、サーボモータ8a、8b、10、12、24(図示せず)などを制御する制御部17が設けられており、この制御部17はケーブル21を介してモニタ18やキーボード19、パソコン本体20と接続されており、かかる制御部17での各種処理のためのデータがキーボード19から入力され、画像認識カメラ16a、16bで捉えた画像や制御部17での処理状況がモニタ18で表示される。

【0012】また、キーボード19から入力されたデータなどは、パソコン本体20の外部記憶装置でフロッピディスクなどの記憶媒体に記憶保管される。

【0013】図2は図1に示すペースト収納筒13と距離計14との部分を拡大して示す斜視図であって、13 aはノズル、22は基板、23はペーストパターンであり、図1に対応する部分には同一符号を付けている。

【0014】同図において、距離計14は下端部に三角形の切込部があって、その切込部に発光素子と複数の受光素子とが設けられている。ノズル13aは、距離計14の切込部の下部に位置付けられている。距離計14は、ノズル13aの先端部からガラスからなる基板22の表面(上面)までの距離を非接触の三角測法で計測する。即ち、上記三角形の切込部での片側の斜面に発光素子が設けられ、この発光素子から放射されたレーザ光しは基板22上の計測点Sで反射し、上記切込部の他方の斜面に設けられた複数の受光素子のいずれかで受光される。従って、レーザ光しはペースト収納筒13やノズル13aで遮られることはない。

【0015】また、基板22上でのレーザ光しの計測点 Sとノズル13aの直下位置とは基板22上で僅かな距離 AX、AYだけずれるが、この僅かな距離 AX、AY 程度ずれた位置間では、基板22の表面のうねり(凹凸)に差がないので、距離計14の計測結果とノズル13aの先端部から基板22の表面までの距離との間に差は殆ど存在しない。従って、この距離計14の測定結果に基づいてサーボモータ12を制御することにより、基板22の表面のうねりに合わせてノズル13aの先端部から基板22の表面までの距離を一定に維持することができ、基板22上に塗布されるペーストパターン23の幅や厚さが一様になる。

【0016】図3は図1に示した制御部17の構成やペースト収納筒13の空気圧の制御, 基板22の制御を示すブロック図であって、17aはマイクロコンピュータ、17bはモータコントローラ、17c1, 17c2

はX1、X2軸ドライバ、17dはY軸ドライバ、17eはの軸ドライバ、17fはZ軸ドライバ、17gはデータ通信バス、17hは外部インターフェース、24はの軸移動テーブル5(図1)を駆動するサーボモータ、25~29はエンコーダ、30は正圧源、30aは正圧レギュレータ、31は負圧原、31aは負圧レギュレータ、32はバルブユニットであり、図1及び図2に対応する部分には同一符号をつけている。

【0017】同図において、制御部17は、マイクロコンピュータ17aやモータコントローラ17b、X、Y、Z、の各軸ドライバ17c1~17f、画像認識カメラ16a、16bで得られる映像信号を処理する画像処理装置17i、キーボード19などとの間の信号伝送を行なう外部インターフェース17hを内蔵している。制御部17は、さらに、基板搬送コンベア2a、2bの駆動制御系を含むが、ここでは、図示を省略している。

【0018】また、マイクロコンピュータ17aは、図 示しないが、主演算部や後述するペーストの塗布描画を 行なうための処理プログラムを格納したROM, 主演算 部での処理結果や外部インターフェース17h及びモー タコントローラ17bからの入力データを格納するRA M, 外部インターフェース17hやモータコントローラ 17bとデータをやりとりする入出力部などを備えてい る。各サーボモータ8a, 8b, 10, 12, 24に は、回転量を検出するエンコーダ25~29が設けられ ており、その検出結果をX, Y, Z, θ の各軸ドライバ 17c1~17fに戻して位置制御を行なっている。 【0019】サーボモータ8a, 8b, 10がキーボー ド19から入力されてマイクロコンピュータ17aのR AMに格納されているデータに基いて正逆回転すること により、負圧源131から分配した負圧によって基板吸 着盤4(図1)に真空吸着された基板22に対し、ノズル 13a(図2)が、Z軸移動テーブル9(図1)を介して、 X, Y軸方向に任意の距離を移動し、その移動中、マイ クロコンピュータ17aがバルブユニット32を制御す ることにより、正圧源30から、正圧レギュレータ30 aとバルブユニット32とを介して、ペースト収納筒1 3に僅かな空気圧が印加され、ノズル13aの先端部の 吐出口からペーストが吐出されて基板22にペーストが 所望のパターンが塗布される。このZ軸移動テーブル9 のX, Y軸方向への水平移動中に距離計14がノズル1 3aと基板22との間の距離を計測し、この距離を常に 一定に維持するように、サーボモータ12が2軸ドライ バ17fで制御される。

【0020】また、ペースト塗布を行なわない待機状態では、マイクロコンピュータ17aがバルブユニット32を制御することにより、負圧レギュレータ31a及びバルブユニット32を介して負圧源31がペースト収納筒13に連通し、ノズル13aの吐出口から垂れ出たペ

ーストをペースト収納筒13内に引き戻す。これにより、この吐出口からのペーストの液垂れを防止することができる。なお、図示しない画像認識カメラでこのノズル13aの吐出口を監視し、液垂れが生じたときのみ、負圧源31をペースト収納筒13に連通するようにしてもよい。

【0021】図4は図1に示した実施形態の一連の動作を示すフローチャートである。

【0022】同図において、まず、この実施形態のペー スト塗布機に電源が投入されると (ステップ100)、 その初期設定が実行される(ステップ200)。この初 期設定工程では、図1において、サーボモータ8a、8 b, 10を駆動することにより、Z軸移動テーブル9を X, Y方向に移動させて所定の基準位置に位置決めし、 ノズル13a (図2) を、そのペースト吐出口がペース トを吐出開始させる位置(即ち、ペースト塗布開始点) に位置付けられるように、所定の原点位置に設定すると ともに、さらに、ベーストパターン描画の対象とする基 板(以下、実基板という)に塗布する1以上のペースト パターン毎のデータ (以下、ペーストパターンデータと いう) や実基板の位置データ, 実基板に実際にペースト を塗布するときのこの実基板とノズルとの間の相対速度 (これを塗布速度というが、特にこの場合の塗布速度を 初期設定塗布速度という) と基板表面からのノズルの高 さ (これを塗布高さというが、特にこの場合の塗布高さ を初期設定塗布高さという) とノズルからのペースト吐 出量を決めるペースト収納筒13に印加される圧力(こ れを塗布圧力というが、特にこの場合の塗布圧力を初期 設定塗布圧力という)との夫々のデータ,ペースト吐出 終了位置を示す位置データ、塗布したペーストパターン の計測位置データなどの設定を行なう。かかるデータの 入力はキーボード19 (図1) から行なわれ、入力され たデータはマイクロコンピュータ17a (図3) に内蔵 されたRAMに格納される。

【0023】この初期設定処理工程(ステップ200)が終了すると、次に、図1において、所望形状のペーストパターンが精度良く塗布できるか否かを判断するために用いるダミー基板(図示せず)を基板吸着盤4に載置して吸着保持させる(ステップ300)。このダミー基板載置工程では、ダミー基板が、基板搬送コンベア2a,2bによってX軸方向に基板吸着盤4の上方まで搬送され、次いで、図示しない昇降手段によってこれら基板搬送コンベア2a,2bを下降させることにより、基板吸着盤4に載置される。

【0024】次に、ベースト塗布動作時での可動部の振動の有無を測定するために、このダミー基板を用いて模擬的にベーストを塗布する動作(ベースト模擬塗布動作)を行なう。このベースト模擬塗布動作の目的は、実基板上にベーストパターンを塗布描画するときの可動部の振動発生個所を検出するとともに、かかる個所での振

動が発生しなくなる最大の塗布速度を求め、さらに、この求めた塗布速度に対する塗布高さ、塗布圧力を求めるものである。なお、上記の初期設定処理工程(ステップ200)で設定される上記の初期設定塗布速度や初期設定塗布高さ、初期設定塗布圧力は、経験などによって決められたペーストパターンの直線部をペースト塗布するときのものである。

【0025】かかるペースト模擬塗布動作では、ノズル13aと基板22(図2)との間の距離の変化から振動の有無を測定するのであるが、このための振動測定センサとして距離計14を用いる。また、このペースト模擬塗布動作に使用されるペーストパターンは実基板に使用される n個(但し、nは、通常、2以上の整数)のペーストパターンであって、上記のように、それらのペーストパターンデータがキーボード19(図1)から入力されてマイクロコンピュータ17a(図3)のRAM(以下、単にメモリという)に、例えば、実基板でのペースト塗布の際に使用される順に1,2,……,nと番号が付されて格納されている。

【0026】かかるペースト模擬塗布動作を開始するに当って、まず、振動測定センサとして使用される距離計14をダミー基板上の所定の高さに位置決めする(ステップ400)。そして、模擬塗布動作に使用するペーストパターンのデータをメモリに格納されているペーストパターンデータから選択してその番号をメモリに格納する。最初では、番号1のペーストパターンデータが選択される(ステップ500)。

【0027】そこで、まず、マイクロコンピュータ17 a (図3)は、直ちにこの選択した番号1のペーストパターンデータを用いてサーボモータ8a,8b.10を制御し、ノズル13aをこの番号1のペーストパターンデータによって規定されるペーストパターンに沿って上記の初期設定途布速度で移動させることにより、模擬途布動作を開始させる(ステップ600)。この場合、ノズル13aからはペーストが吐出されず、また、サーボモータ12は制御されない。

【0028】この模擬塗布動作の開始とともに、距離計 14によってノズル13aと基板22との間の距離を順 次測定し、この測定データを垂直方向の距離測定結果と してペーストパターンデータが表わす位置データと関連 付けてメモリに格納する(ステップ700)。

【0029】図5はこの距離測定処理工程(ステップ700)の詳細を示すフローチャートである。

【0030】同図において、距離計14によってノズル13aと基板22との間の距離を順次測定し(ステップ710)、順次得られる測定結果を距離データとして上記の位置データと関連付けてメモリに格納する(ステップ720)。かかる距離データの測定・格納の処理は、模擬塗布動作を行なっている番号1のペーストバターンが終了するまで続ける(ステップ730)。

【0031】かかる距離測定処理工程(ステップ700)が終了すると、距離計14を上方に待避させ(ステップ800)、得られた距離データから許容範囲外の振動発生位置、即ち、ペーストバターン上での許容範囲外の振動が発生するペースト途布位置の探索・判定(ステップ900)を行なう。

【0032】図6はこの許容範囲外の振動発生パターンの探索処理工程(ステップ900)の詳細を示したフローチャートである。

【0033】同図において、まず初めに、探索・判定すべき距離データが存在するか否かを判定する(ステップ910)。距離データでの探索・判定が終了したときには、探索・判定すべき距離データが存在しないものとして、許容範囲判定フラグ用の変数V_Fに値0を代入する(ステップ950)。一方、距離データでの探索・判定が終了していない場合には、次の距離データを読み込んでデータ変換を行なう(ステップ920)。

【0034】このデータ変換処理を図7によって説明すると、図7(a)は距離測定によって得られた距離データ(波形1)を示すものであって、この距離データの緩やかなうねりはダミー基板の表面のうねりによるものであり、サーボモータ12に制御がかからないため、距離計14はこのうねりによるノズル13aと基板22との間の距離の変化を測定する。また、この距離データの部分aでの急激な変化は、距離計14(従って、ノズル13a)の上下振動によるものであり、塗布速度、即ち、ノズルの移動速度が速すぎた状態でノズル13aの移動方向が変化するときに発生する。

【0035】図7(a)に示す振動部分が予め設定された許容範囲外にあるか否かを判定できるようにするために、距離データのうちのダミー基板の表面のうねりによる変化分を除去し、振動による変化分が顕著に現われるようにデータ変換を行なう。その一方法として、距離データを微分処理する方法があり、かかる処理によって得られるデータを図7(b)に示す。

【0036】図7(b)において、変換データ(波形2)では、ダミー基板の表面のうねりによる変化分は上記の許容範囲内に入り、ノズル13aの振動による変化分が顕著に現われるようになる。

【0037】図6におけるステップ930は、この変換された距離データについて、上記の許容範囲外となる部分りがあるか否かを判定するものであり、この部分りが一箇所でもあれば、この許容範囲外となる全ての部分りの番号1のペーストパターンデータでの位置データ(即ち、このペーストパターンデータによるペーストパターン上の位置)を検出するとともに、許容範囲判定フラグ用の変数V_Fに値1を代入する(ステップ940)。また、この番号1のペーストパターンデータに対して検出された距離データの終わりまで上記の判定処理を行なっても(ステップ910)、許容範囲外の部分りが1つ

もない場合には(ステップ930)、上記のように、許容範囲判定フラグ用の変数V_Fに値0を代入する(ステップ950)。

【0038】なお、上記の距離データのデータ変換方法としては、上記の微分処理による方法に限るものではなく、前後のデータ値の差分を取る差分処理による方法など、ダミー基板の表面のうねりによる変化分を抑圧して振動による変化分が顕著に現われるようにできれば、如何なる方法でもよい。

【0039】以上が図4のステップ900であって、番号1のペーストパターンデータによる塗布速度を上記の初期設定塗布速度で行なった1回目の模擬塗布動作で振動が発生した位置が検出されたことになる。これによると、振動が発生しなかった位置では、番号1のペーストパターンデータで実基板の実際のペースト塗布を行なうときでの塗布速度を上記の初期設定塗布速度とすることができることになる。

【0040】このステップ900の処理が終了すると、次に、変数V_Fの値が1か否か判定し(ステップ1000)値が1の場合には、途布条件修正工程(ステップ1100)に移る。以下、図8により、この塗布条件修正処理工程(ステップ1100)について説明する。

【0041】同図において、まず、上記の初期設定塗布 速度を予め決められた値だけ小さくして新たな塗布速度 とする(ステップ1110)。

【0042】ところで、一般に、塗布速度を減少させた場合には、ノズル13aからの単位移動距離当りのペースト吐出量が多くなるため、ペーストパターンの幅が大きくなるし、高さも高くなり、所望形状のペーストパターンが得られなくなる。このために、ペーストの吐出圧力、つまり、塗布圧力を減少させることによってペースト吐出量を減少させ、所望形状のペーストパターンが得られるようにすることが必要となる。

【0043】このことから、ステップ1110で初期設定塗布速度を上記所定量だけ減少させて新たな塗布速度として、この新たな塗布速度に対して塗布圧力の減少を必要とするか否かを判定し(ステップ1120)、かかる塗布圧力の変更を必要する場合には、新たな塗布速度の変更値を判断基準にして予め決められた値分塗布圧力を減少させる(ステップ1130)。

【0044】次に、新たな塗布速度に対して、塗布時のノズル設定高さ(塗布高さ)の変更が必要か否かを判定し(ステップ1140)、変更を必要とする場合には、塗布圧力の変更とと同様に、塗布速度の変更値を判断基準にして予め決められた値分塗布高さを上昇させる(ステップ1150)。

【0045】以上のステップ1100の処理が終わると、上記の番号1のペーストバターンデータを用いた最初の模擬塗布動作で検出された振動発生個所での塗布速度,塗布圧力,塗布高さを上記新たに設定された塗布速

度,塗布圧力,塗布高さとする。そして、図4におい て、これら新たな塗布速度、塗布圧力、塗布高さで同じ 番号1のペーストパターンデータを用いたステップ40 0からの上記の一連の2回目の模擬塗布動作を行なう。 【0046】この2回目の模擬塗布動作でも、振動が許 容範囲外の個所が存在する場合には、塗布条件修正工程 (ステップ1100)で、このとき使用した塗布速度を 上記のように修正してさらに新たな塗布速度を設定する とともに、必要に応じて塗布圧力と塗布高さも修正し (図8のステップ1130, 1150)、振動が許容範 囲外の個所の塗布速度、塗布圧力、塗布高さをかかる修 正された塗布速度、塗布圧力、塗布高さに変更する。従 って、上記2回目の模擬塗布動作で振動が許容範囲内に 小さくなった個所では、1回目の模擬塗布動作で求めら れた上記の新たな塗布速度、塗布圧力、塗布高さが設定 されたままとなっている。

【0047】このようにして、2回目の模擬塗布動作で新たな塗布速度、塗布圧力、塗布高さが求められると、この条件で同じ番号1のペーストパテーンデータを用いる3回目の模擬塗布動作をステップ400から開始し、以下、変数V_Fが値0になるまで繰り返す(ステップ1000)。このようにして、番号1のペーストパターンデータに対して、これによるペーストパターン上での各位置の塗布速度や塗布圧力、塗布高さが得られることになる。この場合、このペーストパターンの直線部の各個所では、初期設定塗布速度や初期設定塗布圧力、初期設定高さが割り当てられ、また、大きな振動を生ずる個所ほど、割り当てられる塗布速度が小さくなり、これに応じて塗布圧力や塗布高さが決められる。

【0048】図9は以上の模擬塗布動作によって得られるデータを模式的に示すものであって、番号1のペーストパターンデータによるペーストパターン上の塗布位置をS1~S7の7個としている。

【0049】図9(a)は最初の模擬塗布動作の場合を示 すものであって、初期設定塗布速度をVa、初期設定塗 布圧力をFa、初期設定塗布高さをHaとしている。い ま、この最初の模擬塗布動作で塗布位置S2,S5に許 容範囲外の振動が発生したものとすると、図9(b)に示 すように、これら塗布位置S2, S5に対する塗布速度 を初期設定塗布速度 V゚から V, に修正し(この場合、こ れらでの塗布圧力を下っから下」に修正する必要がある が、塗布高さは修正しない必要がないものとしてい る)、この新たな塗布速度V」で2回目の模擬塗布動作 を行なう。この2回目の模擬塗布動作で塗布位置S2に 許容範囲外の振動が生ずると、図9(c)に示すように、 この塗布位置S2に対する塗布速度を塗布速度V₁から V₂に修正し(この場合、塗布圧力を修正する必要がな いが、塗布高さをH。からH」に修正する必要があるもの としている)、この新たな塗布速度V,で3回目の模擬 塗布動作を行なう。この3回目の模擬塗布動作でいずれ の塗布位置でも許容範囲外の振動が生じなければ、これでもってこの番号1のペーストパターンデータを用いた 模擬塗布動作を終了し、このペーストパターンデータに 対して、各塗布位置での塗布速度や塗布圧力、塗布高さ を図9(c)に示すものに決定する。

【0050】以上のようにして番号1のペーストバターンデータに対する模擬塗布動作が終了すると(ステップ1000)、次に、番号2のペーストバターンデータが選択され(ステップ1200)、ステップ400からの上記の模擬塗布動作が繰り返され、以下、番号3,4,……の順にペーストバターンデータによる模擬塗布動作が行なわれる。この場合、各ペーストバターンデータの1回目の模擬塗布動作では、塗布速度、塗布圧力、塗布高さとしてステップ200で初期設定された初期設定塗布速度、初期設定塗布圧力、初期設定高さが用いられる。

【0051】最後の番号nまでの全てのペーストパターンデータについて変数V_Fが値0になって模擬塗布動作が終了すると(ステップ1200)、夫々のペーストパターンデータ毎に、ペーストパターン上の各個所での塗布速度、塗布圧力、塗布高さが設定されたことになり、これにより、実基板でのペースト塗布描画時にノズル13aに発生する振動が所望の塗布ペーストパターンの精度に影響しない条件に設定されたものとして、ダミー基板を排出し(ステップ1300)、次に説明する実基板の生産(ペーストパターンの塗布描画)に移る。

【0052】まず、実基板を基板吸着盤4(図1)に載置して吸着保持させる(ステップ1400)。この基板 載置工程では、基板搬送コンベア2a, 2b(図1)に よって実基板がX軸方向に基板吸着盤4の上方まで搬送され、図示しない昇降手段によってこれら基板搬送コンベア2a, 2bを下降させることにより、実基板を基板 吸着盤4に載置する。

【0053】次に、基板予備位置決め処理(ステップ1500)を行なう。この処理では、図1において、図示しない位置決めチャックにより、この実基板のX、Y方向の位置合わせが行われる。また、基板吸着盤4に載置された実基板の位置決め用マークを画像認識カメラ16a、16bで撮影し、位置決め用マークの重心位置を画像処理で求めて実基板のθ方向での傾きを検出し、これに応じてサーボモータ24(図3)を駆動し、そのθ方向の傾きも補正する。

【0054】なお、ベースト収納筒13内のベースト残量が少なくなり、ベーストパターンの塗布動作中にベーストが途切れる可能性がある場合には、前もってベースト収納筒13をノズル13aとともに交換するが、ノズル13aを交換したときには、その交換前と比較して、取付位置の位置ずれが生じて再現性が損なわれることもある。そこで、再現性を確保するために、実基板上のベーストを塗布しない箇所に交換した新たなノズル13a

を用いて十字状にペスートを塗布し、この十字塗布バターンの交点の重心位置を画像処理で求め、この重心位置と実基板上の位置決め用マークの重心位置との間の距離を算出して、これをノズル13aのペースト吐出口の位置がれ量dx,dy(図2)とし、マイクロコンピュータ17aに内蔵のRAMに格納する。これが実基板に対する基板予備位置決め処理(ステップ1500)であり、かかるノズル13aの位置がれ量dx,dyを用いて、後に行なうペーストバターンの塗布描画時でのノズル13aの位置がれを補正するようにする。

【0055】次に、番号1のペーストパターンデータか ら順番にペーストパターン塗布処理 (ステップ160 0)を行なう。この処理では、塗布開始位置にノズル1 3aの吐出口を位置付けるために、Z軸移動テーブル9 (図1)を移動させ、ノズル位置の比較・調整移動を行 なう。このために、まず、先の基板予備位置決め処理 (ステップ1500)で得られてマイクロコンピュータ 17aのRAMに格納されたノズル13aの位置ずれ量 dx, dyが、図2に示したノズル13aの位置ずれ量 の許容範囲 ΔX , ΔY 内にあるか否かの判断を行なう。 許容範囲内(即ち、△X≥dx及び△Y≥dy)であれ ば、そのままとし、許容範囲外 (即ち、△X<d x また は△Y<dy)であれば、この位置ずれ量dx, dyを 基にZ軸移動テーブル9を移動させてペースト収納筒1 3を調整することにより、ノズル13aのペースト吐出 口と実基板の所望位置との間の位置ずれを解消させ、ノ ズル13aを所望位置に位置決めする。

【0056】次に、ノズル13aの高さの設定を行なう。ペースト収納筒13が交換されていないときには、ノズル13aの位置ずれ量dx,dyのデータはないので、ペーストパターン塗布処理(ステップ1600)に入ったところで、直ちにノズル13aの高さ設定を行なう。この設定される高さは先の模擬塗布動作で用いた初期設定塗布高さに設定され、ノズル13aの吐出口から実基板の表面までの距離がペーストの厚み、即ち、この塗布高さになるようにするものである。

【0057】以上の処理が終了すると、次に、マイクロコンピュータ17aのRAMに格納されているペーストパターンデータに基づいてサーボモータ8a,8b,10(図1)が駆動され、これにより、ノズル13aのペースト吐出口が、実基板に対向した状態で、このペーストパターンデータに応じてX、Y方向に移動するとともに、正圧源30(図3)からペースト収納筒13に僅かな空気圧が印加されてノズル13aのペースト吐出口からペーストが吐出し始める。このときの塗布速度は先の模擬塗布動作で用いた初期設定塗布速度であり、また、空気圧は先の模擬塗布動作で用いた初期設定塗布圧力に応じたものである。これにより、実基板へのペーストパターンの塗布描画が、先の模擬塗布動作で得られた塗布速度で開始される。

【0058】この塗布描画動作の開始とともに、マイクロコンピュータ17aは、先の模擬塗布動作で得られたデータに基づいて、ペーストパターンの塗布位置に応じて塗布速度や塗布圧力,塗布高さを制御する。図9(c)に示すデータを例にとると、塗布位置S1では塗布速度を V_0 , 塗布圧力を F_0 , 塗布高さを H_0 とし、塗布位置S2に近づくとともに、塗布速度を V_2 , 塗布圧力を F_1 , 塗布高さを H_1 として、この塗布位置S2でかかる塗布速度,塗布圧力,塗布高さとなるようにする。これにより、塗布位置S2をペースト塗布するときには、可動部に上記の許容範囲外の大きな振動は生じない。また、この塗布位置S2を過ぎると、塗布速度,塗布圧力、塗布高さをもとの V_0 , F_0 , H_0 に戻し、次に、塗布位置S5近くになると、塗布速度を V_1 に、塗布圧力を F_1 に夫々変更する。

【0059】また、かかるペーストパターンの描画とともに、マイクロコンピュータ17aは距離計14からノズル13aのペースト吐出口と実基板の表面との間の距離の実測データを入力して実基板の表面のうねりを測定し、この測定値に応じてサーボモータ12を駆動することにより、実基板の表面からのノズル13aの設定高さが一定になるように維持されてペーストパターンの塗布描画が行なわれる。

【0060】このようにして、ペーストパターンの塗布 描画が進むが、ペーストパターンの塗布描画動作を継続 するか、終了するかの判定は、塗布点がペーストパター ンデータによって決まる塗布すべきペーストパターンの 終端であるかどうかの判断によって決定され、終端でな ければ、再び実基板の表面のうねりの測定処理に戻り、 以下、上記の各工程を繰り返して、ペーストパターンの 塗布終端に達するまで継続する。

【0061】かかるペーストパターンの塗布動作は設定された n個のペーストパターンデータの全てについて行なわれ、最後の番号 nのペーストパターンデータによるペーストパターンの終端に達すると、サーボモータ12を駆動してノズル13aを上昇させ、このペーストパターン塗布工程(ステップ1600)を終了させる。

【0062】次に、基板排出処理(ステップ1700)に進む。この処理工程では、図1において、実基板の基板吸着盤4への吸着が解除され、基板搬送コンベア2 a、2bを上昇させてこれに実基板22を載置させ、その状態でこの基板搬送コンベア2a、2bにより装置外に排出する。

【0063】そして、以上の全工程が終了したか否かで判定し(ステップ1800)、複数枚の実基板に同じペーストパターンデータを用いてペーストパターンを塗布する場合には、別の実基板に対して基板載置処理(ステップ1400)から繰り返される。そして、全ての実基板についてかかる一連の処理が終了すると、作業が全て終了(ステップ1900)となる。

【0064】なお、上記実施形態では、ノズルが可動部として、基板を固定部としたが、本発明はこれに限るものではなく、ノズルを固定部、基板を移動部とするようにしてもよい。

【0065】以上のように、この実施形態では、ダミー 基板を用いて模擬塗布動作を行ない、前もって塗布すべきペーストバターンデータでの塗布条件を決定するため に、実基板に対して無駄な塗布動作を行なう必要がなく、歩留まりの向上が図れる。

【0066】また、ペーストパターンの直線部と曲線部、つまりペーストパターンの形状に応じて実基板での塗布条件(即ち、塗布速度や塗布圧力,塗布高さ)を決定するので、実基板でのペーストパターンの塗布描画においては、可動部(ノズル部または実基板)の振動を描画するペーストパターンに影響しない程度に小さくすることができるし、また、塗布精度を確保して単位時間当たりのペースト塗布量を一定にすることができ、所望形状のペーストパターンを高い精度で塗布形成することが可能となる。

【0067】さらに、ペーストバターンの曲線部では、可動部での振動の影響が大きいために、そこでの塗布速度を高めることが不可能でも、かかる振動の影響が生じない最大の塗布速度とすることができるし、また、直線部では振動の影響が小さいために、そこでの塗布速度を高めることができる。従って、ペーストバターンの塗布描画を良好に行なうことができて、生産性の向上が図れる。

[0068]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 可動部の振動を抑えることができる範囲内で可能な最大 の途布速度を設定することができ、所望形状のペースト パターンの良好な塗布描画を可能として生産性が大幅に 向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるペースト塗布機の一実施形態を示す斜視図である。

【図2】図1におけるペースト収納筒と距離計との部分 を拡大して示す斜視図である。

【図3】図1における制御部の構成とその制御系統とを

示すブロック図である。

【図4】図1に示した実施形態の全体動作を示すフローチャートである。

【図5】図4における振動測定処理工程の詳細を示すフローチャートである。

【図6】図4における振動発生ベーストパターンの探索・判定処理工程の詳細を示すフローチャートである。

【図7】図6における距離データ読み込み、変換工程と 許容範囲外か否かの判定工程の説明図である。

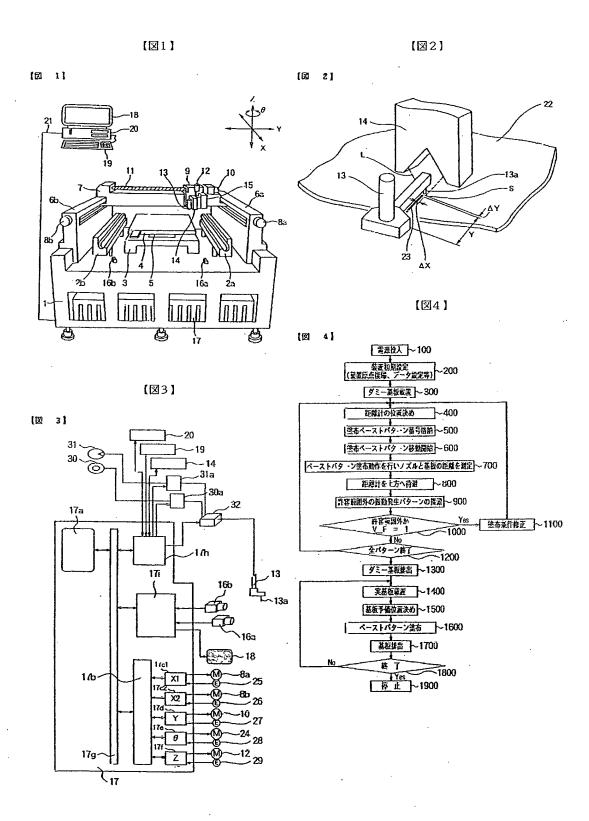
【図8】図4における塗布条件修正処理工程の詳細を示すフローチャートである。

【図9】図4における塗布条件修正工程による塗布条件の変化を説明するための図である。

【図10】従来のペースト塗布機で塗布されたペースト パターンの厚み変化を示す図である。

【符号の説明】

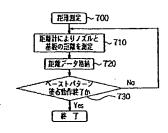
- 1 架台
- 2a, 2b 基板搬送コンベア
- 4 基板吸着盤
- 5 θ軸移動テーブル
- 6a, 6b X軸移動テーブル
- 7 Y軸移動テーブル
- 8a, 8b, 10, 12, 24 サーボモータ
- 9 Z軸移動テーブル
- 10,12 サーボモータ
- 13 ペースト収納筒
- 13a ノズル
- 14 距離計
- 17 制御部
- 22 基板
- 23 ペーストパターン
- 25~29 エンコーダ
- 30 正圧源
- 30a 正圧レギュレータ
- 31 負圧源
- 31a 負圧レギュレータ
- 32 バルブユニット
- S 計測点
- L レーザ光

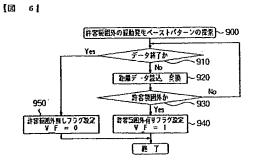


【図5】

【図6】

[EQ 5]

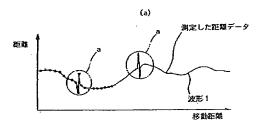


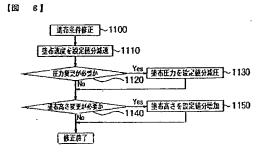


【図7】

【図8】

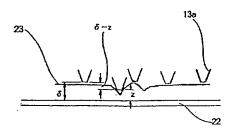
[図 7]





【図10】

[図10]



【図9】

(c) (a) (b) Vo SI **S2** Fo ٧ı Fı Vo Ho S3 Fo ۷o Fo V٥ V٥ Fo **S4** V_0 Fo Ho Fo ·Ho Ha F1 S5 V_0 Ho Ho **S6** Vo \$6 Vo Fq

フロントページの続き

(72)発明者 米田 福男

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72)発明者 三階 春夫

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内